

業績書（教育職員免許法施行規則第 22 条の 6 号関係）

氏 名	笠間 邦彦	学 位	理学博士
担当授業科目	物理学 I , 物理学Ⅲ, 物理学Ⅳ		

1 経歴, 学会及び社会における活動等

<p>学歴：東北大学理学部 1971年4月～1975年3月 東北大学大学院理学研究科修士課程 1975年4月～1977年3月 東北大学大学院理学研究科博士課程 1977年4月～1980年3月</p> <p>職歴：特殊法人理化学研究所 博士研究員 1980年4月～1982年9月 日本電気株式会社 超 LSI 開発本部、ULSI 開発研究所等 1982年9月～2008年6月 技術研究組合 極端紫外線露光システム技術開発機構 1982年7月～2011年3月 ウシオ電機株式会社 EUV 事業部等 2011年4月～2018年3月 ウシオ電機株式会社 顧問 2018年4月～現在に至る 千葉大学工学部 非常勤講師 2014年10月～2019年3月 東京海洋大学海洋工学部 非常勤講師 2019年4月～現在に至る</p> <p>所属学会 応用物理学会（同シリコン分科会も含む）</p> <p>受賞歴など 無し</p>
--

2 著 書

著 書 名	単著・共著の別	発 行 所 名	刊行年月日	備 考
1. 「新版 ULSI デバイス・プロセス技術」	共著	電子情報通信学会出版	2013年5月	
2. 「EUV(Extreme Ultra-Violet)露光システムの開発状況」	単著	真空ジャーナル	2010年3月	

3 学術論文等

学 術 論 文 等 の 名 称	単独・共同の別	発 表 雑 誌 等 名	発行年月日	備 考
1. "High-radiance LDP source: clean, reliable and stable EUV source for mask inspection"	共著	SPIE Advanced Lithography, vol.9766, p.97660L-1~8.	2016年2月	

2. “High-radiance LDP source for mask inspection application(2)”	共著	SPIE Advanced Lithography, vol.9422, p.94220F1~9.	2015年2月	
3. “High-radiance LDP source for mask inspection application”	共著	SPIE Advanced Lithography, vol.9048, p.904813-1~8.	2014年2月	

4 学会発表等

発表課題の名称	単独・共同の別	発表学会等の名称	発表年月日	備考
1. ”High-radiance LDP source for mask inspection and beam line application”	共著	International EUV Symposium 2017	2017年9月	
2. ”Sn-fueled high-brightness compact EUV light source”	共著	International EUV Symposium 2016	2016年10月	
3. ”High-radiance LDP source for mask inspection(2)”	共著	International EUV Symposium 2015	2015年10月	
4. ”High-radiance LDP source for mask inspection”	共著	International EUV Symposium 2014	2014年10月	
5. ”High-radiance LDP source for mask inspection application”	単独	PMJ 2014	2014年10月	

以上